

TECHSPEC®

Siliziumlaserspiegel, unbeschichtet, 600 - 1000 nm, 25,4 mm Durchmesser

Produkt #90-139

NEU

1 In Stock

-

1

+

€99.⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€99,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Flat Mirror

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

<3

Parallelität (Bogenminuten):

90

Freie Apertur (%):

Commercial Polish

Rückseite:

25.40 +0.00/-0.10

Durchmesser (mm):

6.35 ±0.10

Dicke (mm):

Ground, protective bevel as needed

Kanten:

Optische Eigenschaften

40-20

Oberflächenqualität:

N/A

Beschichtungsspezifikation:

0 ±30fs² @ 600 - 1000nm

GDD-Spezifikation:

600 - 1000

Wellenlängenbereich (nm):

λ/1

Oberflächenebenheit (P-V):

Uncoated

Beschichtung:

Optical Grade Silicon

Substrat: ☐

Konformität mit Standards

[Anzeigen](#)

Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Siliziumsubstrat für thermisch anspruchsvolle Ultrakurzpuls-laser-Aufbauten
- Ideal für Ti:Saphir- und Yb-basierte Ultrakurzpuls-laser-Systeme
- Konzipiert für Ultrakurzpuls-Reflexion, bei der eine geringe Dispersion wesentlich ist
- GDD <30 fs² in den Ziel-Wellenlängenbereichen

TECHSPEC® Silizium-Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit Enhanced-Silber-Beschichtung vereinen eine breitbandige Enhanced-Silber-Beschichtung mit geringer Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) für Ultrakurzpulsanwendungen. Diese Spiegel sind für Systeme konzipiert, bei denen die Aufrechterhaltung der Pulsgenauigkeit von entscheidender Bedeutung ist. Reflektivität und GDD sind über den angegebenen

Wellenlängenbereich von 600 bis 1000 nm bzw. 800 bis 1150 nm charakterisiert. Diese Siliziumsubstratspiegel weisen eine höhere Wärmeleitfähigkeit auf als vergleichbare [Quarzglassubstrat-Spiegel](#), wodurch die absorbierte Wärme in thermisch anspruchsvollen optischen Aufbauten gleichmäßig verteilt wird. TECHSPEC® Silizium-Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit Enhanced-Silber-Beschichtung eignen sich ideal für eine breitbandige Ultrakurzpuls-Strahlführung, wo eine hohe Reflektivität, eine kontrollierte Dispersion und ein thermisch robustes Substrat erforderlich sind.
